



△				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				CHAMFER 一般面取		QUANTITY 個數
△				J. A.	T. A.	TREATMENT 処理				FINISHING 仕上		
△	07.08.20	3	WD 公差を変更 2→3.3			TREATMENT CONTACT 処理接点				DECENTRATION 偏芯		
△	05.05.09	2	WD 公差を変更	DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000	±0.3	±0.5	±1.0	±0.2	UNIT (mm)	REMARK 適用 (機種名)
△	05.04.25	1	マウント部分の機構を変更	T. T.	T. M.	OVER 63 UP TO 250	±0.2	±0.3	±0.6	±0.15		
	DATE	EXCH NO.	REVISION 変更記事					OVER 16 UP TO 63	±0.1	±0.2	±0.4	±0.1
						OVER 0 UP TO 16	±0.05	±0.1	±0.2	±0.1	DATE	DRAW NO.
						TOLERANCES	A	B	C	S	'05.06.06	ODTC0013A2